

# BECA ICPNA ARTUS WIELS

EDICIÓN 2023

## BASES DE CONVOCATORIA 2023

### 1. PRESENTACIÓN

---

El Instituto Cultural Norteamericano (ICPNA) y ARTUS se unen para poner en marcha la convocatoria al Programa de Residencia Artística WIELS, una plataforma de producción multidisciplinar internacional que alberga artistas contemporáneos emergentes y de media carrera de diversas partes del mundo.

WIELS es un laboratorio internacional para la creación y difusión del arte contemporáneo que provee un espacio de trabajo único para los artistas, en el que pueden continuar su labor desde la experimentación y la innovación en torno a las prácticas de arte contemporáneo. Asimismo, es una institución que integra, en un mismo lugar, las funciones de presentación, producción y educación, en la que los artistas residentes cuentan con el servicio de acompañamiento a proyectos mediante tutorías individuales y colectivas.

Las Becas ARTUS tienen como objetivo apoyar el crecimiento artístico, la reflexión creativa y el desarrollo profesional de artistas jóvenes peruanos a través de becas para residencias artísticas internacionales.

Se invita a artistas visuales de nacionalidad peruana, con dominio moderado de inglés hablado que les permita expresarse con fluidez, a participar en el concurso por la Beca ARTUS-ICPNA a ser llevada a cabo en la Residencia WIELS, en Bruselas, Bélgica, entre Julio y diciembre de 2023. No existe limitación para participar por razón de edad o lugar de residencia.

Los postulantes no pueden haber participado con anterioridad en el programa de Residencias Artísticas WIELS.

## 2. OBJETIVO

El objetivo fundamental de la presente convocatoria, es proporcionar la movilidad internacional a un artista visual peruano, otorgándole durante 6 meses un programa de mentoría que incluye un espacio de trabajo individual e interacciones profesionales dentro de la vida artística y cultural de Bruselas. Mediante esta Residencia se busca también establecer conexiones entre la escena artística de Bruselas y del Perú.

## 3. POSTULACIÓN

Las solicitudes se cursarán en inglés a más tardar el día 20 de Noviembre de 2022, vía email a: [residency@icpna.edu.pe](mailto:residency@icpna.edu.pe)

Se debe incluir los siguientes documentos:

A. Formato de Aplicación (LINK).

B. Curriculum Vitae actualizado.

C. Declaración del Artista: En 250 palabras o menos escribir un texto sobre tu trabajo.

D. Declaración de Propósito: En 300 palabras o menos describir sus proyectos potenciales, ideas y expectativas para la residencia Wiels, incluyendo algunas ideas sobre el proyecto que quisieran desarrollar durante su permanencia en la Residencia.

E. Referencias: Indicar nombre, email y teléfono de tres (3) referencias que pudieran comentar sobre su trabajo y su desarrollo artístico a nivel profesional.

F. Portafolio de Proyectos: Seleccionar hasta 10 imágenes o videos que serán enviados por email con la aplicación en JPG o PDF, tamaño máximo A4 y con resolución 72 DPI (cada imagen será denominada con el Apellido del Artista, guion bajo, Nombre del Artista y el número de la imagen (ej. Cortes\_Carlos01). Cada video será considerado una imagen. Los videos con documentación sobre el proceso de creación no serán vistos.

G. Descripción de las Imágenes incluida en el portafolio con la indicación de título, fecha, medios, dimensión y una pequeña descripción de cada obra (no más de 50 palabras por cada imagen/video).

H. Copia del Documento de Identidad.

Los artistas son íntegramente responsables de la información y la data que presentan en su aplicación y de las obligaciones que asumen en consecuencia. Se entiende que el artista postulante es el único autor de la propuesta presentada.

En caso de no cumplir con cualquiera de los requisitos o de las disposiciones de fondo y/o forma establecidas para la aplicación o en caso de no tener disponibilidad para participar en el Programa de Residencia WIELS durante el íntegro de la duración de la misma, el artista será descalificado del proceso.

#### 4. SELECCIÓN Y CRITERIOS DE VALORACIÓN

La etapa de preselección y selección de la convocatoria estará a cargo de un jurado formado por tres profesionales del campo artístico que serán designados por cada una de las partes.

El jurado adjudicará el premio fundamentando por escrito las razones de su decisión y sus decisiones serán inapelables. Asimismo, no se podrá declarar desierto el premio, como tampoco podrá hacerse nominaciones compartidas.

La elección para el beneficiario de la residencia se desarrollará de la siguiente manera:

A. Preselección de un máximo de 5 (cinco) artistas sobre la base de su aplicación.

B. Los 5 artistas preseleccionados realizarán una presentación informativa a los benefactores de Artus.

C. De ser necesario, los artistas preseleccionados serán entrevistados por el jurado, quien asignará a un único ganador. Los criterios de valoración del ganador serán principalmente la innovación y originalidad del proyecto a desarrollar, tanto en el

planteamiento conceptual como en la formalización del proyecto, calidad y creatividad del proyecto, viabilidad del proyecto y relevancia del espacio expositivo receptor del proyecto.

- D. La decisión final será tomada en enero de 2023. El artista seleccionado será notificado vía email o teléfono indicado en su aplicación y será anunciado al público en general a través de los canales de comunicación de Wiels, de ARTUS y del ICPNA.
- E. Si el ganador de la Beca no comunica su aceptación de la misma dentro de las 48 horas de haber sido enviado el mail de comunicación, quedará automáticamente descalificado y la Beca será otorgada al primer finalista.
- F. Una vez otorgada la asignación de la Beca, el beneficiario deberá entregar en la sede del ICPNA ubicada en Av. Angamos Oeste N° 120 - Miraflores, firmado y en físico, el formulario de aceptación del otorgamiento de la residencia que le será enviado.

## 5. DOTACIÓN PARA LA RESIDENCIA

4

La Beca incluye:

- Pasaje desde su lugar de residencia hasta Bruselas ida y vuelta.
- Estudio de trabajo de 40 m<sup>2</sup> y de uso individual dentro de la sede de Wiels y en el periodo previsto para su residencia.
- Alojamiento en apartamento equipado cercano a Wiels, incluyendo los gastos de electricidad, agua, calefacción e internet durante el periodo previsto para su residencia.
- 800 Euros por cada mes de estancia, por concepto de manutención y ayuda a la producción.
- Acceso a las instalaciones de Wiels, así como participación en las actividades desarrolladas dentro de su programa para residentes.
- Tutorías semanales por parte de artistas y creadores/as integrados en la plantilla de tutores/as del Programa de Residencia de Wiels.
- Un viaje de campo dentro o fuera de Bélgica. Los gastos de viaje y alojamiento estarán cubiertos, a excepción de las comidas, las cuales correrán por cuenta del beneficiario.
- Una presentación / conferencia pública durante la residencia
- Visitas de Estudio por curadores, artistas críticos invitados por WIELS.

- Opción de una pequeña exhibición individual o colectiva en el Cuarto de Proyectos WIELS en los meses o años posteriores a la Residencia, sujeto a disponibilidad del espacio y en coordinación con el Coordinador del Programa. Esto no generara costos adicionales para ARTUS o ICPNA y los fondos necesarios deberán ser conseguidos por el Artista.

## 6. DURACIÓN

El Programa de Residencia WIELS tiene una duración aproximada de 6 meses que van desde Julio a diciembre de 2023. Las fechas de viaje del artista pueden ser flexibles.

## 7. PLAZOS Y DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR

- El plazo de inscripción será del 3 de octubre al 20 de noviembre de 2022.
- El formulario de registro se cerrará a las 00:00 hrs del 21 de noviembre y no se aceptarán solicitudes más allá de este horario.
- El artista seleccionado será anunciado en enero de 2023.

## 8. PASAPORTE Y VISA

Es responsabilidad del beneficiario de la Beca tener el pasaporte vigente y realizar el trámite de visa y demás documentos legales que sean necesarios para realizar el viaje. WIELS podrá entregar una constancia de participación en la Residencia, si fuera necesario. Si la visa no fuera obtenida de forma oportuna, queda sin efecto el otorgamiento de la Beca y se elige a un nuevo beneficiario dentro de los 4 otros preseleccionados.

## 9. PROPIEDAD INTELECTUAL

Los participantes responden de la originalidad y autoría de los proyectos que presenten, y garantizan que ostentan legítimamente todos los derechos de propiedad intelectual sobre los mismos. En este sentido garantizan el uso pacífico de dichos proyectos por parte

de ICPNA y ARTUS, quienes se eximen expresamente de cualquier responsabilidad por los daños o perjuicios que directa o indirectamente pudiera ocasionar el incumplimiento de esta garantía por parte del participante.

Los autores autorizan a ICPNA y ARTUS el uso de los distintos elementos del proyecto, ya sean textos, imágenes, gráficos o videos para fines promocionales o publicaciones de las actividades.

## 10. DERECHOS DE IMAGEN DE LOS PARTICIPANTES

Los participantes reconocen que ellos y el material que presenten podrán aparecer en imágenes (fotografía, video, etc.) tomadas en relación a su residencia para su posterior difusión informativa o promocional por parte de ICPNA y ARTUS.

Asimismo, acepta que su imagen y la de sus creaciones puedan ser utilizadas en catálogos u otros documentos recopilatorios de la actividad realizados por ICPNA y ARTUS.

## 11. DATOS PERSONALES

Con el envío de la información de sus datos para participar de este evento, usted autoriza a ICPNA y ARTUS a que almacenen y traten su información personal, conforme lo señalado en la Ley de Protección de Datos personales – Ley 29733 y su Reglamento.

El participante entiende y acepta que esta autorización será ilimitada en el tiempo y solo terminará si envía una comunicación indicando expresamente su ánimo de cancelar la autorización aquí brindada, esta comunicación deberá ser enviada por escrito a la sede del ICPNA ubicada en Miraflores o al correo [icpna@icpna.edu.pe](mailto:icpna@icpna.edu.pe)

## 11. ACEPTACIÓN DE LOS TERMINOS

Los participantes, por el hecho de presentarse a la convocatoria, aceptan los términos y condiciones de las presentes bases.